## Проверка применимости модели моновалентного дефекта для описания свойств комплекса вакансия–кислород в кремнии

© Л.Ф. Макаренко¶

Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Белоруссия

(Получена 9 февраля 2000 г. Принята к печати 30 марта 2000 г.)

Исследованы температурные зависимости концентрации носителей заряда в кристаллах кремния *n*-типа проводимости, выращенных по методу Чохральского и облученных гамма-квантами <sup>60</sup>Со. Проведен анализ применимости модели моновалентного дефекта с уровнем вблизи  $E_c$ —0.17 эВ для описания свойств *A*-центра в кристаллах *n*-Si. Показано, что модель не согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Высказано предположение, что *A*-центр имеет в верхней половине запрещенной зоны два уровня: акцепторный вблизи  $E_c$ —0.16 эВ и донорный вблизи  $E_c$ —0.20 эВ. Это предположение согласуется с данными, полученными с использованием магнитно-спектроскопических методов.

Структура комплекса кислород-вакансия в кремнии (A-центр) известна уже давно [1], но многие его свойства все еще не находят удовлетворительного объяснения. Одним из таких свойств является чрезвычайно высокая рекомбинационная активность А-центра, проявляемая вследствие весьма больших сечений захвата как электронов ( $\sigma_n$ ), так и дырок ( $\sigma_n$ ) [2]. Согласно [2,3], теория многофононных переходов не позволяет объяснить столь высокие значения сечений захвата носителей на акцепторное состояние А-центра (по крайней мере для  $\sigma_p$ ). Причины такого несоответствия теории и экспериментальных данных все еще не ясны. Одна из них может заключаться в непримеримости теории многофононных переходов к вакансионным центрам [2]. Однако, возможно, несоответствие возникает из-за того, что наши представления об А-центре в кремнии п-типа как о простом моновалентном дефекте не соответствуют действительности.

Эти представления возникли прежде всего на основании данных холловских измерений, из которых было установлено, что А-центр имеет акцепторный уровень  $E_A(-/0) \approx E_c - 0.17$  эВ [4,5]. Чаще всего (см. [16]) цитируется значение энергии ионизации, полученное Вертхеймом в [4]:  $\Delta E_A = 0.160 + 1.1 \cdot 10^{-4}$  T, эВ, где, как обычно,  $\Delta E_A = E_c - E_A(-/0)$ . В работе [5] был проведен более детальный анализ данных холловских измерений. Оказалось, что значения энтальпии ( $\Delta H_A$ ) и энтропии ( $\Delta S_A$ ) ионизации A-центра, полученные для материалов, имеющих разные соотношения между концентрациями доноров и компенсирующих радиационных дефектов, могут существенно различаться. Поэтому наряду с определением значений  $\Delta H_A$  и  $\Delta S_A$  желательно проводить какую-либо оценку адекватности описания экспериментальных данных при помощи используемой функции заполнения. К сожалению, такой оценки не было сделано в полной мере ни в указанных выше, ни в многочисленных последующих работах, посвященных изучению А-центра при помощи эффекта Холла.

Результаты работ, посвященных емкостным исследованиям радиационных дефектов в кремнии, также не позволяют судить об адекватности модели моновалентного дефекта. Параметры A-центра, определенные различными авторами, имеют весьма большой разброс, который, на наш взгляд, превышает ожидаемый. Так, в [7] для  $\Delta H_A$  приводят значение 0.15 эВ, а в материалах для кремниевых детекторов  $\Delta H_A = 0.19$  эВ [8]. Кроме того, влияние электрического поля *p*-*n*-перехода на скорость эмиссии электронов с акцепторного уровня A-центра [9,10] затрудняет интерпретацию данных, полученных при исследовании барьерных структур с различными концентрациями примесей.

Таким образом, имеющиеся экспериментальные данные не позволяют утверждать, что модель моновалентного дефекта достаточна для описания функции заполнения *А*-центра в кремнии *n*-типа проводимости. Следовательно, эта модель должна рассматриваться только как гипотеза, требующая проверки. Такая проверка и составляет предмет настоящей работы.

Исследовался монокристаллический кремний *n*-типа, выращенный по методу Чохральского, с удельным сопротивлением 20 Ом·см, концентрацией кислорода  $[O]= 0.9 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$  и углерода  $[C]= 5 \times 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Измерялись температурные (T = 78-320 K) зависимости коэффициента Холла ( $R_H$ ). Концентрация носителей заряда (n) рассчитывалась по стандартной формуле  $n = A_H(T)/eR_H$ , где  $A_H(T)$  — холл-фактор. Температурная зависимость холл-фактора аппроксимировалась полиномом, аналогично тому, как это делалось в [5,11].

Для введения А-центров образцы облучались гаммаквантами <sup>60</sup>Со. Доза облучения выбиралась в соответствии с условием слабой компенсации, чтобы концентрация А-центра ( $N_A$ ) была меньше концентрации легирующей примеси фосфора ( $N_P$ ). Согласно многочисленным экспериментальным данным [2,12–14], в слабо легированных ( $n < 10^{16}$  см<sup>-3</sup>) кристаллах кремния *n*-типа, выращенных по методу Чохральского и облученных гаммаквантами <sup>60</sup>Со, А-центр является превалирующим электрически активным дефектом, а концентрация остальных центров с уровнями в верхней половине запрещенной зоны пренебрежимо мала.

<sup>¶</sup> Fax: (017)2265548

E-mail: makarenko@fpm.bsu.minsk.by



**Рис. 1.** Температурные зависимости концентрации носителей заряда в кристалле кремния сразу после облучения гаммаквантами <sup>60</sup>Со дозой  $\Phi = 2.5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  (1) и после отжига при 352°С в течение 15 (2) и 40 мин (3).

На рис. 1 приведены температурные зависимости концентрации электронов n(T) для одного из исследованных образцов, измеренные как сразу после облучения, так и после нескольких циклов изотермического отжига при 352°С. В результате облучения вводится радиационный дефект с уровнем вблизи *E*<sub>c</sub>-0.18 эВ, обозначаемый далее как E(0.18). Простейший способ идентификации дефектов из холловских данных заключается в определении его уровня по положению уровня Ферми  $(F_{1/2})$  при температуре, для которой функция заполнения дефекта равна 1/2, и, следовательно, соответствует концентрация электронов  $n = (N_{net} - N_{low})/2$ (N<sub>net</sub> и N<sub>low</sub> указаны на рис. 1). Во всех кристаллах для E(0.18) получено значение  $F_{1/2} = E_c - 0.183$  эВ, которое согласуется с данными работ [4,11]. Температура и постоянная времени отжига E(0.18) также согласуются с результатами, полученными при исследовании А-центра методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и инфракрасной (ИК) спектроскопии [15–16], что служит дополнительным подтверждением идентификации исследуемого центра как комплекса кислород-вакансия.

Вначале проведем анализ применимости одноуровневой модели, используя дифференциальную методику [17]. Согласно [17], параметры дефекта можно определить из зависимости от уровня Ферми (*F*) величины

$$D_H = \frac{4}{N_A} kT \frac{dn}{dF}.$$
 (1)

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 10

Численная аппроксимация  $D_H$  в настоящей работе выбиралась в виде

$$\Delta_H = \frac{2}{N_A} k T_i \left[ \frac{\Delta n_i}{\Delta F_i} + \frac{\Delta n_{i+1}}{\Delta F_{i+1}} \right], \qquad (2)$$

где  $\Delta n_i = n_{exp}(T_i) - n_{exp}(T_{i-1})$  и  $\Delta F_i = F_{exp}(T_i) - F_{exp}(T_{i-1})$ , а  $n_{exp}(T_i)$  и  $F_{exp}(T_i)$  есть экспериментально определенные значения концентрации и уровня Ферми соответственно. Такая аппроксимация позволяет частично сглаживать колебания  $\Delta_H$ , возникающие вследствие случайных ошибок эксперимента.

Максимальное значение  $\Delta_H$  для одновалентного дефекта с  $\Delta S_A = 0$  должно быть практически равно единице [17,18]. Однако для А-центра максимальное значение  $\Delta_H$  существенно ниже единицы (см. рис. 2). Это может свидетельствовать о том, что  $\Delta S < 0$  [18]. Действительно, зависимость  $\Delta_H(F)$ , рассчитанная для значений  $\Delta H_A$  и  $\Delta S_A$ , приведенных в [4], значительно лучше согласуется с экспериментальными данными, чем аналогичная зависимость, рассчитанная для  $\Delta H_A = F_{1/2}$ и  $\Delta S_A = 0$  (см. рис. 2). Но ни та ни другая кривая, рассчитанные по одноуровневой модели, не могут удовлетворительно описать экспериментальные данные во всем исследуемом интервале температур. Так, например, если кривая А хорошо описывает высокотемпературную часть экспериментальной зависимости, то кривая В только ее низкотемпературную часть.



**Рис. 2.** Зависимости величины  $\Delta_H$  от расстояния между дном зоны проводимости  $(E_c)$  и уровнем Ферми (F). Обозначения экспериментальных кривых те же, что и на рис. 1. Расчетные кривые  $\Delta_H$  вычислялись на основании уравнения электронейтральности по одноуровневой модели для значений  $\Delta H_A = 0.183$  эВ и  $\Delta S_A = 0$  (A) и с параметрами, взятыми из [4]:  $\Delta H_A = 0.160$  эВ и  $\Delta S_A = -1.25k$  эВ/К (B); а также по модели дивалентного центра с параметрами, взятыми из [21]:  $\Delta H_1 = 0.158$  эВ и  $\Delta S_1 = -0.5k$  эВ/К,  $\Delta H_2 = 0.205$  эВ и  $\Delta S_2 = 0.4k$  эВ/К (C).



**Рис. 3.** Температурные зависимости величины  $\varepsilon(T)$ . Обозначения экспериментальных кривых те же, что и на рис. 1. Прямыми показаны зависимости  $\Delta E_A(T)$ , построенные по данным работ [4] —  $\Delta H_A = 0.160$  эВ,  $\Delta S_A = -1.25k$  эВ/К (W) и [5] —  $\Delta H_A = 0.146$  эВ,  $\Delta S_A = -2.3k$  эВ/К (*S&T*); а кривая M рассчитана по модели дивалентного центра с параметрами, взятыми из [21]:  $\Delta H_1 = 0.158$  эВ и  $\Delta S_1 = -0.5$  эВ/К,  $\Delta H_2 = 0.205$  эВ и  $\Delta S_2 = 0.4$  эВ/К.

Причина несоответствия расчетных и экспериментальных зависимостей  $\Delta_H(T)$  становится ясной из рассмотрения температурных изменений величины

$$\varepsilon(T) = kT \ln \frac{N_c}{n} \frac{N_{net} - n}{n - N_{low}},$$
(3)

где  $N_c$  — эффективная плотность состояний в зоне проводимости. Согласно [19], для моновалентного дефекта  $\varepsilon(T) = \Delta E(T) = \Delta H_A - T \Delta S_A$ . Если речь не идет об очень низких температурах, и если начальная и конечная температуры измерений не отличаются более чем в 2–3 раза, то величины  $\Delta H_A$  и  $\Delta S_A$  можно считать практически постоянными и зависимость  $\Delta E(T)$  будет линейной [20]. Это предположение обычно принимается как постулат и может использоваться в качестве критерия применимости одноуровневой модели.

Экспериментальные кривые  $\varepsilon_{\exp}(T)$  представлены на рис. 3. Здесь же построены зависимости  $\Delta E_A(T)$ , полученные в работах [4,5]. Как следует из рисунка, формула Вертхейма представляет собой линейную аппроксимацию зависимости  $\varepsilon_{\exp}(T)$  во всем исследуемом интервале температур, а прямая, построенная согласно данным работы [5], есть очень хорошая линейная аппроксимация, но только ее низкотемпературного участка. Однако видно, что в целом экспериментальные кривые  $\varepsilon_{\exp}(T)$  не могут быть описаны линейным законом. Следовательно, для объяснения экспериментальных данных холловских измерений необходимо предположить, что либо энергия ионизации *A*-центра имеет аномальную нелинейную зависимость от температуры, либо используемая модель описания его свойств неприменима. Первое предположение, по-видимому, маловероятно с точки зрения физического смысла величин  $\Delta H_A$  и  $\Delta S_A$  [20]. Из второго следует необходимость использования более сложной модели для описания функции заполнения *A*-центра.

В [21] была предложена новая модель, в которой А-центр рассматривается как амфотерный дефект с акцепторным уровнем вблизи  $E_c$  – 0.16 эВ и донорным вблизи  $E_c$  – 0.20 эВ. Как видно из рис. 2 и 3, эта модель хорошо объясняет особенности экспериментальных зависимостей как  $\Delta_H(F)$ , так и  $\varepsilon(T)$ . Она позволяет также объяснить данные холловских измерений в кристаллах кремния, облученных большими дозами гамма-квантов (см. работу [22], в которой для *А*-центра наблюдался разброс энергий активации от 0.16 до 0.20 эВ). Кроме того, это предположение согласуется и с данными, полученными другими методами.

Простейшим тестом применимости модели двухвалентного дефекта к *А*-центру являются, по-видимому, данные ЭПР спектроскопии. *А*-центр является парамагнитным только в отрицательно заряженном состоянии (центр Si-B1) [1]. Тогда в соответствии с данной моделью концентрация центров Si-B1 в кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского, должна быть равна  $(N_{net} - N_{low})/2$ . В то же время из рис. 1 следует, что уменьшение концентрации примесных атомов фосфора в парамагнитном состоянии будет пропорционально величине  $N_{net} - N_{low}$ . Таким образом, следует ожидать, что рост амплитуды сигнала ЭПР, связанного с Si-B1, будет составлять только половину от уменьшения сигнала, связанного с донорами фосфора, что хорошо солгласуется с экспериментальными данными [23].

Если у А-центра имеется донорный уровень, то после облучения величина N<sub>net</sub> должна была бы возрасти до значения  $N_{net}^{irr} = N_{\rm P} + N_A$ , и после окончания ионизации А-центра мы наблюдали бы увеличение концентрации носителей заряда на величину N<sub>A</sub> по сравнению с исходной концентрацией примеси фосфора. Поскольку такого увеличения не наблюдается, мы должны предположить, что одновременно с А-центром при облучении образуется еще один акцепторный дефект с практически той же самой скоростью введения. Более того, как следует из рис. 1, этот акцепторный центр должен также отжигаться совершенно идентично А-центру. Хотя, на первый взгляд, такая корреляция кажется маловероятной, однако логически ее можно ожидать для генетически связанных радиационных дефектов. Более того, именно такое поведение обнаружено из данных релаксационной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) для E(0.18) и ловушки для дырок *H*(0.42) [12].

Предполагается, что центр H(0.42) связан с комплексом  $C_iO_i$  [23–25]. В свою очередь корреляция в пространственном распределении *А*-центра и комплекса  $C_iO_i$  согласуется с результатами работы [26] об электронных переходах между этими центрами в облученном кремнии. Именно результатом действия этого межпримесного механизма рекомбинации можно объяснить аномально высокую рекомбинационную активность комплекса кислород–вакансия в кремнии.

Таким образом, в настоящей работе показано, что представления об *A*-центре в кремнии, как о дефекте, имеющем только один акцепторный уровень в верхней половине запрещенной зоны, не соответствует экспериментальным данным измерений коэффициента Холла. Более удовлетворительной является модель, согласно которой *A*-центр в кремнии имеет акцепторный уровень вблизи  $E_c$ -0.16 эВ и донорный уровень вблизи  $E_c$ -0.20 эВ.

## Список литературы

- [1] G.D. Watkins, J.W. Corbett. Phys. Rev., **121**, 1001 (1961).
- [2] А.С. Зубрилов, С.В. Ковешников. ФТП, 25, 1332 (1991).
- [3] С.М. Дикман. ФТП, **26**, 1427 (1992).
- [4] G.K. Wertheim. Phys. Rev., **106**, 1272 (1958).
- [5] E. Sonder, L.C. Templeton. J. Appl. Phys., **31**, 1279 (1960).
- [6] В.В. Емцев, Т.В. Машовец. Точечные дефекты в полупроводниках (М., Радио и связь, 1980) с. 95.
- [7] C.A. Londos. Phys. St. Sol. (a), **113**, 503 (1989).
- [8] Е.М. Вербицкая, В.К. Еремин, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан. ФТП, 27, 1113 (1993).
- [9] B.A. Komarov, V.I. Sopryakov. Phys. St. Sol. (a), 66, 783 (1981).
- [10] K. Irmsher, H. Klose, K. Maas. Phys. St. Sol. (a), 75, K25 (1983).
- [11] H.J. Stein, F.L. Vook. Phys. Rev., 163, 790 (1967).
- [12] L.C. Kimerling. *Radiation Defects in Semicond.*, ed. by N.B. Urli and J.W. Corbett (Inst. of Physics and Phys. Soc., London, 1977) p. 221.
- [13] S.D. Brotherton, P.J. Bradley. J. Appl. Phys., 53, 5720 (1982).
- [14] Л.С. Берман, В.Б. Воронков, А.Д. Ременюк, М.Г. Толстобров. ФТП, 21, 140 (1987).
- [15] J.W. Corbett, G.D. Watkins. Phys. Rev. A, 135, 1381 (1964).
- [16] B.G. Svensson, J.L. Lindstrom. Phys. Rev., B, 34, 8709 (1986).
- [17] H-J. Hoffmann. Appl. Phys., 19, 307 (1979).
- [18] Л.Ф. Макаренко, В.П. Маркевич, Л.И. Мурин. ФТП, 19, 1935 (1985).
- [19] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников (М., Наука, 1977) гл. 5.
- [20] J.A. Van Vechten, C.D. Thurmond. Phys. Rev. B, 14, 3559 (1976).
- [21] Л.Ф. Макаренко. Докл. АН Беларуси, 40 (4), 59 (1996).
- [22] Н.А. Витовский, Т.В. Машовец, С.М. Рывкин. ФТТ, 4, 2845 (1962).
- [23] G.D. Watkins, J.W. Corbett, R.M. Walker. J. Appl. Phys., 30, 1198 (1959).
- [24] J.M. Trombetta, G.D. Watkins. Appl. Phys. Lett., 51, 1103 (1987).
- [25] L.I. Murin. Phys. St. Sol. (a), 101, K107 (1987).
- [26] A.M. Frens, M.T. Bennebroek, A. Zakrzewski, J. Schmidt, W.M. Chen, E. Janzen, J.L. Lindstrom, B. Monemar. Phys. Rev. Lett., 72, 2939 (1994).

Редактор В.В. Чалдышев

## Testing validity of monovalent defect model for oxygen-vacancy complex in silicon

L.F. Makarenko

Belarus state University, 220050 Minsk, Belarus

**Abstract** Temperature dependecies of charge carrier concentration has been investigated on Czochralski-grown *n*-type silicon crystals irradiated by Co-60 gamma-rays. The validity of the model of a monovalent defect with the energy level near  $E_c$ -0.17 eV has been examined to describe A-center properties in *n*-Si. This model is shown to be inconsistent with experimental data available. It it suggested that the A-center should have two levels in the upper part of Si band gap: an acceptor level is about  $E_c$ -0.16 eV and a donor one is about  $E_c$ -0.20 eV. This suggestion is consistent with data obtained with the help of magnetic spectroscopy methods.